

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호
WO 2020/141804 A1

2020 년 7 월 9 일 (09.07.2020)

- (51) 국제특허분류: **C09K 3/14** (2006.01) **C09G 1/04** (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2019/018546
- (22) 국제출원일: 2019 년 12 월 27 일 (27.12.2019)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2018-0173796 2018 년 12 월 31 일 (31.12.2018) KR
- (71) 출원인: 주식회사 동진세미켐 (**DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.**) [KR/KR]; 22824 인천시 서구 백범로 644, Incheon (KR).
- (72) 발명자: 문원균 (**MOON, Weoun Gyuen**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 김재현 (**KIM, Jae Hyun**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 신규순 (**SHIN, Kyu Soon**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 박종대 (**PARK, Jong Dai**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 이민건 (**LEE, Min Gun**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 진성훈 (**JIN, Sung Hoon**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 이구화 (**LEE, Goo Hwa**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 조경숙 (**CHO, Gyeong Sook**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR). 유재홍 (**YOO, Jae Hong**); 18635 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 태웅 (**TW INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM**); 06749 서울시 서초구 강남대로 221, 209호, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,

ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:
— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))



WO 2020/141804 A1

(54) Title: CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING PARTICLE AND POLISHING SLURRY COMPOSITION COMPRISING SAME

(54) 발명의 명칭: 화학-기계적 연마 입자 및 이를 포함하는 연마 슬러리 조성물

(57) Abstract: The present invention provides a chemical-mechanical polishing particle having high polishing quality with a high polishing rate and few defects or scratches by modifying the surface of a polishing particle, and a polishing slurry composition comprising same.

(57) 요약서: 본 발명은 연마 입자의 표면을 개질하여, 높은 연마 속도, 결점이나 스크래치가 작은 양질의 연마 품질을 갖는 화학-기계적 연마 입자 및 이를 포함하는 연마 슬러리 조성물을 제공한다.